(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2010 年 4 月 8 日(08.04.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/038617 A1

(51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2006.01) *C09K 3/14* (2006.01)
C03C 19/00 (2006.01) *G11B 5/84* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2009/066186

(22) 国際出願日: 2009 年 9 月 16 日(16.09.2009)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2008-256103 2008 年 10 月 1 日(01.10.2008) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭硝子株式会社(ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 酒井 智弘 (SAKAI, Tomohiro) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 旭硝子株式会社内 Tokyo (JP). 別府 義久 (BEPPU, Yoshihisa) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 旭硝子株式会社内 Tokyo (JP). 朝長 浩之 (TOMONAGA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1008405 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 旭硝子株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 泉名 謙治, 外 (SENMYO, Kenji et al.); 〒1010035 東京都千代田区神田紺屋町１７番地 ＳＩＡ神田スクエア４階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

(54) **Title**: POLISHING SLURRY, PROCESS FOR PRODUCING SAME, METHOD OF POLISHING, AND PROCESS FOR PRODUCING GLASS SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISK

(54) 発明の名称 : 研磨スラリー、その製造方法、研磨方法および磁気ディスク用ガラス基板の製造方法

(57) **Abstract**: A process for producing a polishing slurry which contains fine ceria crystal particles or fine ceria-zirconia solid-solution crystal particles and which, despite this, can be used to polish the main surface of a glass substrate at a high rate. The process for producing a polishing slurry having a pH of 2-7 is characterized by: producing a polishing slurry concentrate which comprises abrasive grains comprising ceria particles or ceria-zirconia solid-solution particles, a dispersant comprising 2-pyridinecarboxylic acid or glutamic acid, and water; dispersing the abrasive grains of the polishing slurry concentrate so that the diameter of the crystallites of the abrasive grains does not decrease by more than 10%; thereafter adding water; and further adding the same dispersant.

(57) 要約: セリア結晶微粒子またはセリア－ジルコニア固溶体結晶微粒子を用いる場合であってもガラス基板主表面を高速で研磨できる研磨スラリーの製造方法の提供。 セリア粒子またはセリア－ジルコニア固溶体粒子からなる砥粒と２－ピリジンカルボン酸またはグルタミン酸からなる分散剤と水とを含有する研磨スラリー原液を作製し、当該研磨スラリー原液の砥粒をその結晶子径の減少割合が１０％以下となるように分散し、その後、水を加え、また前記分散剤と同じものを添加することを特徴とするｐＨが２～７である研磨スラリーの製造方法。

WO 2010/038617 A1